

両面同時露光マスクアライナー

BS425

80mm角
対応

ウェハ表裏同時露光で高効率
セミオート動作で中ロット生産に対応

φ4”試料対応両面同時露光機

1968年の登場以来ベストセラーの両面同時露光マスクアライナーBSシリーズがモデルチェンジしました。BSシリーズは水晶発振子、電力素子、LED、MEMSなど試料表裏両面加工プロセスを必要とする各種電子デバイスの研究開発から小中ロット製造用として多くの出荷実績がある露光機です。一次露光は両面同時、二次露光以降は片面ずつ露光する方法※を採用するため、シンプルで応用が利くモデルです。各種ニーズに合わせたカスタマイズも承ります。 ※二次露光以降は別途 片面露光用「試料台」が必要になります。

特徴

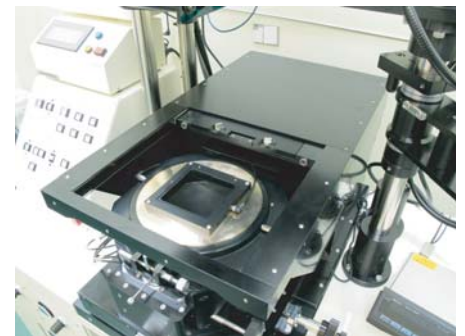
- ◆試料表裏同時露光で高効率、高スループット
- ◆積算光量計による露光量制御(上下独立)
- ◆新型アライメントステージ
- ◆双対物レンズ双眼2視野アライメント顕微鏡搭載
- ◆マスク密着性を改善する試料吹上機能(片面露光時)
- ◆フローティング機能付き球面摺動レベリング機構
- ◆上下マスクアライメント時に透過式照明が利用可能
- ◆試料固定真空度調整(片面露光時)
- ◆フットスイッチによるセミオート運転(1次露光時)
- ◆ウェハ位置決めガイド搭載(オプション)
- ◆ランプ交換が容易な下側ランプハウス前後スライド機構
- ◆上側ランプハウスUV遮光カバー付き



(改良のため仕様・意匠は変更されることがあります)

仕様

適用試料	最大φ4インチ(□80mmにも対応)
適用マスク	最大□5インチ マスク・ウェハサイズ変更は上下マスクホルダ交換
ランプハウス	有効露光範囲 φ125mm Hgランプ250W
UV照度	365nm 18mW/cm ² 、405nm 30mW/cm ² 、照度均一度 約±5%以内
露光解像度	ライン&スペース3μm(露光→現像時)
露光方式	コンタクト露光。片面露光時は試料吹上コンタクト可能。
アライメント方式	双対物2視野顕微鏡による上側マスクと下側マスクまたはウェハ上面同時観察によるマニュアルアライメント。上側マスク位置基準(固定)式。
アライメント顕微鏡	双眼双対物顕微鏡 総合倍率 100×(変倍はオプション) 左右対物レンズ間距離 20~85mm(近接最小間隔8mmはオプション) 観察照明 ハロゲンランプ+ファイバライトガイドによる同軸落射式照明 上下マスクアライメント時には下側ランプハウスからの透過光照明も可能。
アライメントステージ	
X軸(横)、Y軸(縦)	±3mm 手動(微動・粗動調整ダイヤル)
Z軸(上下)	0~1mm エア駆動方式(コンタクト圧調整レギュレータ付) 0~5mm 手動ねじ送り式 ギャップ測長器(分解能1μm)オプション
θ軸	±3° 手動(微動)
平行アジャスト	球面摺動機構(フローティングおよび真空ロック付)
上側マスク駆動	モーター駆動による前後スライド。繰返位置決め XYθ 方向精度±3μm以内/100回
装置寸法・重量	1600(H)×1120(W)×800(D)mm 突起部含まず 350kg以下
ユーティリティ	真空 600mmHg以上 ドライエア 0.6MPa 以上 外径φ6mmチューブ用継手 電源 AC100V 30A



特約店

SANMEI GROUP IDENTITY
sanmei 株式会社 三明
 〒424-0825 静岡県静岡市清水区松原町6-16
 電話 (0543)53-3271 Fax (0543)52-1648

製造元



株式会社 ナノテック
 Nanometric Technology Inc.

〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-5-8-201

www.nanotech-inc.co.jp
info@nanotech-inc.co.jp

電話(03)3960-3171 Fax (03)3960-3174